

s 2018 0098

Invenția se referă la domeniul nanomaterialelor polimerice și a structurilor fotosensibile pe baza lor, care pot fi utilizate în optoelectronică pentru realizarea dispozitivelor fotovoltaice și a purtătorilor de informație electrofotografică. Stratul fotosensibil pe bază de polimer carbazolic conține poli-N-epoxipropilcarbazol sau copolimer carbazolil-etilmetacrilat: octilmetacrilat sensibilizat cu 12...15% mas. de 2,4,7-trinitrofluorenonă și 5,0...50,0% mas. de tetrahidroxifalocianină de zinc sau cobalt, grosimea stratului fotosensibil fiind de 2,0...6,0 μm .

Revendicări: 1

Figuri: 4